

บทที่ 6

สรุปผลการวิจัย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นการศึกษาการปลูกฟิล์มอะมอร์ฟัสซิลิคอนชนิดบริสุทธิ์ และการศึกษาคูณสมบัติการดูดกลืนแสงของวัสดุอะมอร์ฟัสซิลิคอนชนิดบริสุทธิ์ ผลจากการศึกษาในวิทยานิพนธ์นี้สามารถสรุปเป็นข้อๆ ได้ดังนี้คือ

- 1) ประสบความสำเร็จในการปลูกฟิล์ม a-Si:H ชนิดบริสุทธิ์ด้วยวิธี glow discharge plasma CVD
- 2) ได้มีการศึกษาวิธีการวัดสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงของ a-Si:H ชนิดบริสุทธิ์ซึ่งเกิดจากการดูดกลืนแสงด้วยโลคอลไลเซชันด้วยวิธี CPM
- 3) ได้ทำการออกแบบและติดตั้งระบบการวัด CPM ตลอดจนเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์เพื่อให้สามารถวัด CPM ได้อย่างอัตโนมัติ
- 4) ได้ทำการวัดสเปกตรัมของสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงในย่านพลังงานโฟตอนที่น้อยกว่าช่องว่างพลังงานของ a-Si:H ชนิดบริสุทธิ์ที่ปลูกที่อุณหภูมิแผ่นฐานต่างๆ พบว่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงของโลคอลไลเซชันของซิงแกมเหล่านี้ มีค่าประมาณ 10^0 cm^{-1} ที่พลังงานโฟตอน 0.88 eV และเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 10^3 cm^{-1} ที่พลังงานโฟตอนประมาณ 1.7 eV
- 5) ผลการเปรียบเทียบสเปกตรัมของสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงที่วัดด้วยวิธี CPM ของซิงแกมต่างๆ พบว่า สัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงของ a-Si:H ที่ปลูกที่อุณหภูมิแผ่นฐาน 200°C มีค่าน้อยกว่ากรณีที่ปลูกที่อุณหภูมิแผ่นฐาน 100°C และ 300°C
- 6) เมื่อนำข้อมูลของสเปกตรัมการดูดกลืนแสงด้วยโลคอลไลเซชันไปคำนวณหาค่าความหนาแน่นของแกนขาด พบว่าความหนาแน่นของแกนขาดของ a-Si:H ที่ปลูกด้วยอุณหภูมิแผ่นฐาน 100°C , 200°C และ 300°C มีค่า $1.7 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$, $5.4 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ และ $8.5 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ ตามลำดับ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าค่าความหนาแน่นของแกนขาดของ a-Si:H ชนิดบริสุทธิ์ที่ปลูกด้วยอุณหภูมิแผ่นฐานที่ 200°C มีค่าน้อยที่สุด
- 7) ได้มีการวัดความหนาแน่นของแกนขาดของ a-Si:H ชนิดบริสุทธิ์ด้วย ESR พบว่าเงื่อนไขอุณหภูมิแผ่นฐานที่ทำให้ความหนาแน่นของแกนขาดน้อยที่สุดคือ 200°C

- 8) ความหนาแน่นของแขนขาดหรือ defects ในฟิล์ม a-Si:H ชนิดบริสุทธิ์ที่วัดได้จากการวัดด้วยวิธี CPM ได้ผลสอดคล้องกับวิธี ESR และวิธี photoconductivity
- 9) ได้มีการนำผลการหาค่าอุณหภูมิแผ่นฐานที่เหมาะสม ($T_s = 200^\circ\text{C}$) ไปใช้ในการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิด a-Si:H รอยต่อ p-i-n ทำให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด = 6.68%